

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年4月10日(10.04.2025)



(10) 国際公開番号

WO 2025/074559 A1

(51) 国際特許分類:
G03F 7/004 (2006.01) G03F 7/11 (2006.01)
G03F 7/09 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/036334

(22) 国際出願日: 2023年10月5日(05.10.2023)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人: 株式会社レゾナック (RESONAC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 (JP).

(72) 発明者: 戸田 夏木 (TODA Natsuki); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 (JP). 東ヶ崎 慶 (TOGASAKI Kei); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 (JP). 岩下 健一 (IWASHITA Kenichi); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 (JP). 吉原 謙介 (YOSHIHARA Kensuke);

〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 (JP). 賀口 陽介 (KAGUCHI Yosuke); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 (JP). 渡邊 祐作 (WATANABE Yusaku); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社レゾナック内 (JP).

(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 (JP).

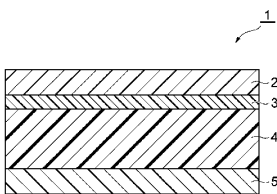
(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,

(54) Title: PHOTSENSITIVE ELEMENT, METHOD FOR FORMING RESIST PATTERN, AND METHOD FOR MANUFACTURING PRINTED WIRING BOARD

(54) 発明の名称: 感光性エレメント、レジストパターンの形成方法及びプリント配線板の製造方法

(57) Abstract: A photosensitive element comprising a support film, an optical adjustment layer, and a photosensitive layer in this order, wherein the optical adjustment layer has an absorbance of 0.060 or less with respect to light having a wavelength of 365 nm, and the optical adjustment layer has a refractive index of 1.800 or less with respect to light having a wavelength of 365 nm.

(57) 要約: 支持フィルムと、光学調整層と、感光層とをこの順で備える感光性エレメントであって、前記光学調整層の波長365nmの光に対する吸光度が0.060以下であり、前記光学調整層の波長365nmの光に対する屈折率が1.800以下である、感光性エレメント。



WO 2025/074559 A1

[続葉有]

PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))